

RAF

Le Workshop du Réseau des Acteurs Français de l'ALD
2ème Edition

ALD



14 - 15 - 16 Novembre 2016

EDF Lab, Chatou/Paris, France

www.rafald.org

Workshop annuel dédié à la technologie **ALD** (Atomic Layer Deposition)
Fédérer la communauté française, industrielle et académique

Thèmes Précurseurs, Croissance, Caractérisations, Simulations, Applications industrielles
Public Chercheurs, Industriels, Ingénieurs, Doctorants, Techniciens, Etudiants

PROGRAMME

Lundi 14

13.00 - 14.00	Accueil
14.00 - 14.30	Introduction
14.30 - 17.00	Tutoriels
17.00 - 19.00	Session Posters

Mardi 15

09.00 - 11.50	Présentations orales - Précurseurs et Simulations
11.50 - 12.40	Tables rondes
14.30 - 17.30	Présentations orales - Croissance et Caractérisations
17.30 - 18.10	Tables rondes
20.00 - 23.00	Dîner de Gala

Mercredi 16

09.00 - 12.30	Sessions oraux - Applications industrielles
12.30 - 12.40	Prix Poster et Prix Oral
15.00 - 17.00	Réunion de travail pour le GDR RAFALD

Soumission des résumés
date limite 15 septembre 2016

Frais d'inscription :
120€ / 80€ (doctorants)
Limité à 100 places
Contact : www.rafald.org



COMITE SCIENTIFIQUE

N. Bahlawane (LIST) - M. Bechelany (IEM)
M. Cassir (Chimie ParisTech) - S. Daniele (IRCELYON)
J.-M. Decams (Annealsys) - C. Dussarat (Air Liquide)
A. Esteve (LAAS) - M. Gros-Jean (STMicroelectronics)
J. Kools (Encapsulix) - L. Morgenroth (IEMN)
D. Muñoz (CEA/Ines) - L. Santinacci (CINaM)
C. Valhas (CIRIMAT) - J. Vitiello (Altatech)
D. Blanc-Pelissier (INL)

COMITE D'ORGANISATION

E. Blanquet (SIMaP) - F. Donsanti (EDF-IRDEP)
R. Gassilloud (CEA/Leti) - C. Jiménez (LMGP)
D. Lincot (CNRS-IRDEP) - T. Maindron (CEA/Leti)
A. Mantoux (SIMaP) - D. Muñoz-Rojas (LMGP)
A. Ringuede (CNRS-Chimie ParisTech)
N. Schneider (CNRS-IRDEP) - C. Vallée (LTM)

